

多弧离子镀沉积过程的计算机模拟



作者：赵时璐著

出版社：北京：冶金工业出版社

出版日期：2013.04

总页数：232

说明：登录教客网（<https://www.jiaoke.com/book/detail/13282432.html>）查找全本阅读方式

多弧离子镀沉积过程的计算机模拟 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/13282432.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/13282432.html>

书名：多弧离子镀沉积过程的计算机模拟